

La litografia High-NA ha visto 'la prima luce': ASML e Intel gongolano

https://www.trendynet.it/wp-content/uploads/2024/02/localimages/intel-asml-high-na-oregon_720.jpg, La messa a punto della litografia High-NA da parte di ASML e Intel procede bene: è stato superato un passaggio fondamentale in vista di un'applicazione nella produzione in volumi di semiconduttori tra il 2025 e il 2030...

[Read More](#)